

ノンパターン・ウエハ表面検査



Nano SOLTECH

WIN-10,20

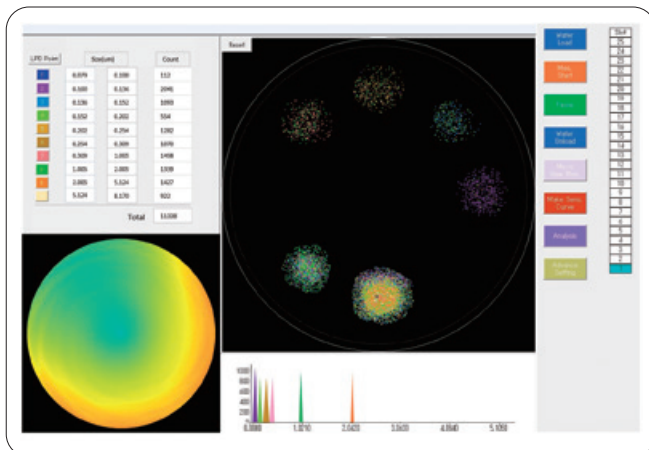
Non-Pattern Wafer Inspection

モニターウエハや出荷前・後ウエハの微小異物やさまざまな欠陥を検査する装置です

- 独自の光学系技術によりCapture Rateを大幅に向上
- 2~8インチ (WIN10) 8~12インチ (WIN20) 対応
- SFS6220, SFS6420 → WIN10
SP1TBI, DLS → WIN20 各装置の代替機として
- 大型モニターでの高い操作性

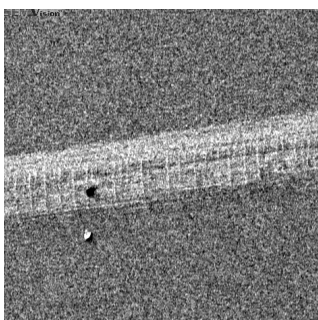
特徴

- 前方散乱光、側方散乱光を広範囲に同時受光することで多様な形状、サイズの異物に対応
- 投光レーザビーム径を可変とすることで、高感度検査から高速検査まで幅広いアプリケーションに対応可能
- 高速サンプリング、検出波形の解析など最新のテクノロジーを駆使して国内で開発・製造
- ユーザーのニーズに合わせてカスタマイズし、ソリューションを提供可能

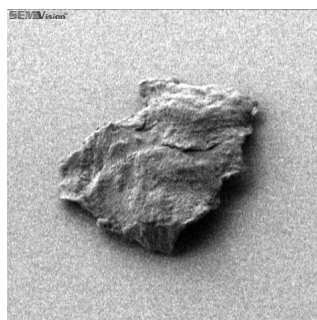


スペック

- WIN-10 : 2~8インチ(3サイズ選択)
- WIN-20 : 8~12インチ
- Sensitivity : 40nm/Bare Si (WIN20)
50nm/Bare Si (WIN10)
- Repeatability : <1%
- Display : 23.8インチタッチパネル
- Robot Wafer搬送(Pre-Aligner搭載)



スクラッチ



異物(SEM画像)

ノンパターン・ウエハ表面検査装置

Nano SOLTECH

WIN-10,20

Non-Pattern Wafer Inspection



操作性の向上

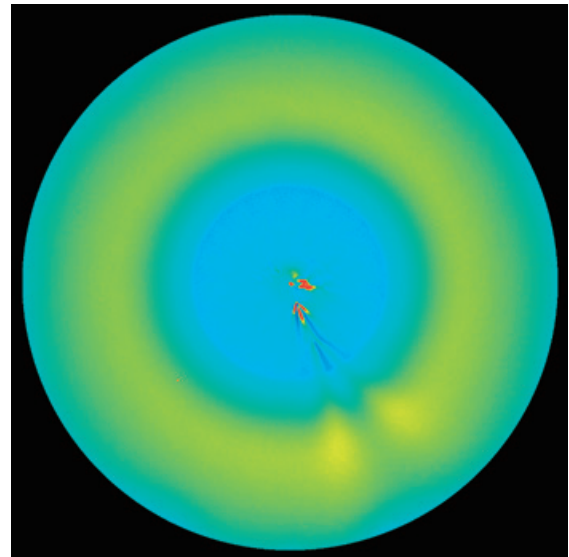
23.8インチの大型タッチパネルを採用、視認性の大幅な向上と快適な操作性を実現し、オペレーターがストレスなく操作出来る装置です。

Haze情報の提供

Haze情報の表示を標準装備。膜厚の不均一性などが高解像度の画面で視認出来ます。

解析ツール/機能(OPTION)

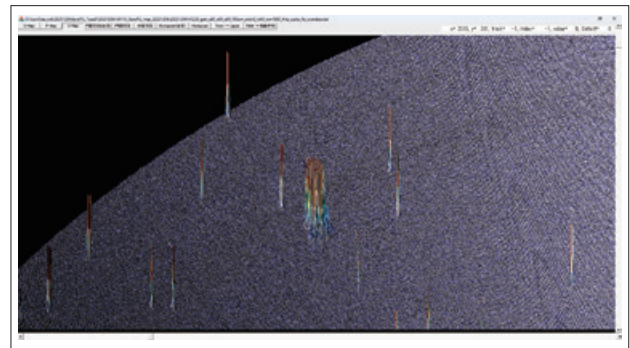
- マップ重ね合わせ
- 異物散乱強度3Dイメージ表示
- 高精度な欠陥座標出力によりReview SEMとのリンクにより、検出欠陥の観察が可能。
- 自動化(GEM/SECS)対応



ウエハ全体で不均一な膜厚を示すHazeマップ

アプリケーション

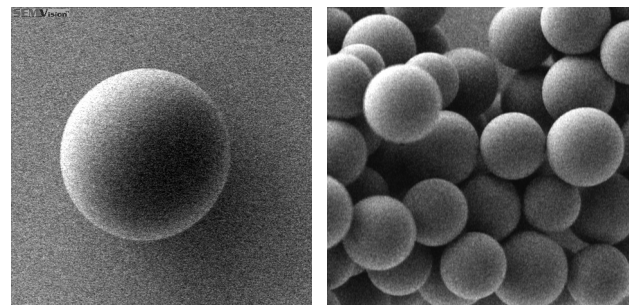
- **半導体メーカー**
パワーデバイスやディスクリート製造におけるプロセス装置のパーティクル管理等
- **材料メーカー**
製品の開発段階及び出荷前のパーティクル検査/管理等
- **装置メーカー**
開発、製造、出荷前のパーティクル管理等



異物散乱強度3Dイメージ

デモンストレーション

- デモセンターにはWIN-10, 20のデモ機を設置しております。
- サンプルへのPSL塗布も対応致します。
- 装置性能の確認ははもちろん、お客様の課題解決や設備導入にあたってのプロセス評価を実機を使って進めることができます。



PSL粒子



ナノ・ソルテック株式会社

本社・ショールーム/デモセンター 〒223-0057 横浜市港北区新羽町2032 demo@nstj.co.jp

URL: <https://nstj.co.jp/home>